

# 中華民國專利證書

發明第 I 274788 號

發明名稱：製備 L10 相合金薄膜的方法

專利權人：國立臺灣大學

發明人：郭博成、黃暉理、許仁華、張慶瑞、孫安正、陳勝吉、周群淵、李長泰、張冕暉

利權期間：自 2007 年 3 月 1 日至 2024 年 12 月 9 日止

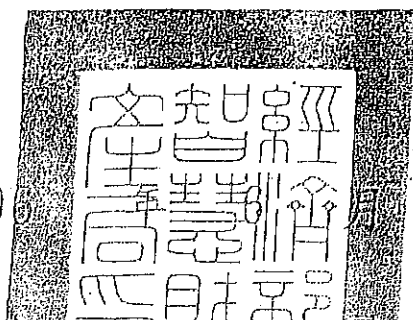
開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

齊部智慧財產局

局長 蔡練生

民國

96



7

日 (換發)

